

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2025年1月2日(02.01.2025)



(10) 国際公開番号
WO 2025/004924 A1

- (51) 国際特許分類:
G03F 7/038 (2006.01) *G03F 7/09* (2006.01)
G03F 7/004 (2006.01) *G03F 7/037* (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2024/022194
- (22) 国際出願日: 2024年6月19日(19.06.2024)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2023-104747 2023年6月27日(27.06.2023) JP
- (71) 出願人: 東レ株式会社(TORAY INDUSTRIES, INC.) [JP/JP]; 〒1038666 東京都中央区日本橋室町2丁目1番1号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 小山 祐太朗(KOYAMA Yutaro); 〒5208558 滋賀県大津市園山1丁目1番1号 東レ株式会社 滋賀事業場内 Shiga (JP). 増田有希(MASUDA Yuki); 〒5208558 滋賀県大津市園山1丁目1番1号 東レ株式会社 滋賀事業場内 Shiga (JP). 杉浦 幹太(SUGIURA Kanta); 〒5208558 滋賀県大津市園山1丁目1番1号 東レ株式会社 滋賀事業場内 Shiga (JP). 松村 和行(MATSUMURA Kazuyuki); 〒5208558 滋賀県大津市園山1丁目1番1号 東レ株式会社 滋賀事業場内 Shiga (JP). 加藤 圭悟(KATO Keigo); 〒5208558 滋賀県大津市園山1丁目1番1号 東レ株式会社 滋賀事業場内 Shiga (JP). 植岡 佳子(TATEOKA Yoshiko); 〒5208558 滋賀県大津市園山1丁目1番1号 東レ株式会社 滋賀事業場内 Shiga (JP).

- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:
一 国際調査報告(条約第21条(3))

(54) Title: NEGATIVE PHOTSENSITIVE RESIN COMPOSITION, NEGATIVE PHOTSENSITIVE RESIN COMPOSITION COATING FILM, NEGATIVE PHOTSENSITIVE RESIN COMPOSITION FILM, CURED FILM, AND ELECTRONIC COMPONENT COMPRISING SAME

(54) 発明の名称: ネガ型感光性樹脂組成物、ネガ型感光性樹脂組成物被膜、ネガ型感光性樹脂組成物フィルム、硬化膜、およびこれらを用いた電子部品

(57) Abstract: The present invention provides a resin composition which has excellent pattern processability in a thick film and does not generate an organic deposit even when processing is performed on a substrate having an aluminum pad electrode. A negative photosensitive resin composition contains (B) a polymerizable compound and (C) a photopolymerization initiator. The content of fluorine atoms in the total solid content of the negative photosensitive resin composition is characterized to be 0.0% by mass to 1.0% by mass inclusive.

(57) 要約: 厚膜での優れたパターン加工性を有し、かつアルミパッド電極を有する基板上で加工処理を行っても有機堆積物が生じない樹脂組成物を提供する。(B) 重合性化合物、及び(C) 光重合開始剤を含有するネガ型感光性樹脂組成物であって、前記ネガ型感光性樹脂組成物の全固形分に占めるフッ素原子の含有量が0.0質量%以上1.0質量%以下であることを特徴とする、ネガ型感光性樹脂組成物である。



WO 2025/004924 A1